

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم

محل انتشار:

فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران، دوره 6، شماره 2 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

عباس زارعیان - موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

آیدین حمیدی - موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

فرشید حسنی - موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

سید علی طباطبائی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

خلاصه مقاله:

تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذر گیاه مادری گندم در آزمایشگاه بررسی شد. در مزرعه، آزمایش در سال زراعی 90-91، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه، کرج و یزد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در سه سطح، از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، از مرحله شروع پرشدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیک و آبیاری نرمال، محلول پاشی پتاسیم در سه سطح، عدم محلول پاشی، محلول پاشی 5/1 و 3 درصد K2O و دو رقم پیش‌تاز و مرودشت و لاین WS-82-9 بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی قبل از بوجاری، کاهش معنی‌دار داشت. بذره‌های لاین WS-82-9 تولید شده در شرایط آبیاری نرمال و بذره‌های رقم مرودشت تولید شده در شرایط تنش شدید خشکی به ترتیب با 77/94 و 5/56 درصد، بیش‌ترین و کم‌ترین درصد جوانه زنی را داشتند. محلول پاشی 3 درصد K2O نسبت به عدم محلول پاشی پتاسیم، درصد جوانه زنی بذر قبل از بوجاری را در یزد و کرج به ترتیب به میزان 47/10 و 65/5 درصد افزایش داد. وزن خشک گیاهچه بیش‌تر، با بذره‌های لاین WS-82-9 در شرایط آبیاری نرمال و محلول پاشی 5/1 درصد (018/0 K2O، گرم) و وزن خشک کم‌تر، با بذره‌های رقم مرودشت در شرایط تنش شدید خشکی و عدم محلول پاشی (009/0 گرم) به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی 3 درصد K2O و استفاده از لاین WS-82-9 در تعدیل اثرات تنش خشکی، به ویژه در مزارعی که در مراحل پایانی دوره رشد با محدودیت آب مواجه هستند، موثر است.

کلمات کلیدی:

تنش خشکی، جوانه زنی بذر، رقم، گندم، محلول پاشی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/969066>

